

<<中国知识产权指数报告2011>>

图书基本信息

书名：<<中国知识产权指数报告2011>>

13位ISBN编号：9787513006002

10位ISBN编号：7513006008

出版时间：2011-6

出版时间：知识产权出版社

作者：王正志 编

页数：289

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国知识产权指数报告2011>>

### 内容概要

《中国知识产权指数报告（2011）》以全球知识产权发展态势为背景，通过文献梳理、实地调研、案例剖析等多种研究方法对我国31个省（区、市）的知识产权具体发展状况和差异进行定性与定量分析，建立起一套科学、系统规范的四级指标体系。

在此基础上，总结和归纳我国知识产权发展中存在的主要问题，并提出相应的政策建议。

《中国知识产权指数报告（2011）》读者对象：知识产权理论和政策研究人员、实务工作者及普通大众。

书籍目录

第一章 区域知识产权综合实力排名与分析

第二章 区域知识产权综合实力一级指标排名与分析

一、知识产权综合实力一级指标框架

二、知识产权综合实力一级指标排名与分析

第三章 知识产权产出水平各项指标排名与分析

一、知识产权产出水平二级指标框架及排名与分析

1. 指标框架

2. 排名与分析

二、知识产权产出人均三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权产出人均三级指标框架及指数排名

2. 专利总量四级指标框架及排名与分析

3. 商标总量四级指标框架及排名与分析

4. 版权总量四级指标框架及排名与分析

5. 集成电路布图设计总量四级指标框架及排名与分析

6. 农业植物新品种总量四级指标框架及排名与分析

三、知识产权产出质量三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权产出质量三级指标框架及指数排名

2. 专利有效性四级指标框架及排名与分析

3. 商标有效性四级指标框架及排名与分析

4. 专利金奖四级指标框架及排名与分析

5. 驰名商标四级指标框架及排名与分析

6. “中华老字号”四级指标框架及排名与分析

7. 集成电路布图设计登记发证四级指标框架及排名与分析

四、知识产权产出效率三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权产出效率三级指标框架及指数排名

2. 人才产出效率四级指标框架及排名与分析

3. 资本产出效率四级指标框架及排名与分析

五、知识产权企业产出三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权企业产出三级指标框架及指数排名

2. 企业产出规模四级指标框架及排名与分析

3. 企业产出质量四级指标框架及排名与分析

4. 企业产出效率四级指标框架及排名与分析

第四章 知识产权流动水平各项指标排名与分析

一、知识产权流动水平二级指标框架及排名与分析

1. 指标框架

2. 排名与分析

二、技术市场交易三级指标框架及排名与分析

1. 技术市场交易三级指标框架及指数排名与分析

2. 技术市场规模四级指标框架及排名与分析

3. 技术市场开放度四级指标框架及排名与分析

4. 技术外溢度四级指标框架及排名与分析

5. 技术国际竞争力四级指标框架及排名与分析

三、知识产权专业服务机构三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权专业服务机构三级指标框架及指数排名

2. 商标服务机构（含律师事务所）四级指标框架及排名与分析

## <<中国知识产权指数报告2011>>

### 3. 专利服务机构四级指标框架及排名与分析

#### 四、企业技改、引进三级指标框架及排名与分析

1. 企业技改、引进三级指标框架及指数排名
2. 技术改造指数四级指标框架及排名与分析
3. 国内引进四级指标框架及排名与分析
4. 国外引进四级指标框架及排名与分析

#### 第五章 知识产权综合绩效各项指标排名与分析

##### 一、知识产权综合绩效二级指标框架及排名与分析

1. 指标框架
2. 排名与分析

##### 二、宏观经济绩效三级指标框架及排名与分析

1. 宏观经济绩效三级指标框架及指数排名
2. 经济发展水平四级指标框架及排名与分析
3. 经济增长方式转变四级指标框架及排名与分析
4. 经济结构优化四级指标框架及排名与分析

##### 三、社会进步绩效三级指标框架及排名与分析

1. 社会进步绩效三级指标框架及指数排名
2. 环境改善四级指标框架及排名与分析
3. 社会发展四级指标框架及排名与分析
4. 社会生活信息化四级指标框架及排名与分析

##### 四、企业发展绩效三级指标框架及排名与分析

1. 企业发展绩效三级指标框架及指数排名
2. 产品升级指数四级指标框架及排名与分析
3. 设备更新指数四级指标框架及排名与分析

#### 第六章 知识产权创造潜力各项指标排名与分析

##### 一、知识产权创造潜力二级指标框架及排名与分析

1. 指标框架
2. 排名与分析

##### 二、知识产权创造投入三级指标框架及排名与分析

1. 创造投入三级指标框架及指数排名
2. 人才投入四级指标框架及排名与分析
3. 资本投入四级指标框架及排名与分析

##### 三、知识产权创造成果三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权创造成果三级指标框架及指数排名
2. 论文四级指标框架及排名与分析
3. 国家产业化项目四级指标框架及排名与分析
4. 科技成果四级指标框架及排名与分析
5. 高新技术产业科技项目四级指标框架及排名与分析

##### 四、知识产权创造环境三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权创造环境三级指标框架及指数排名
2. 财政支持四级指标框架及排名与分析
3. 金融环境四级指标框架及排名与分析
4. 开放四级指标框架及排名与分析
5. 教育环境四级指标框架及排名与分析
6. 高新技术开发区四级指标框架及排名与分析

##### 五、知识产权试点示范三级指标框架及排名与分析

1. 知识产权试点示范三级指标框架及指数排名

## <<中国知识产权指数报告2011>>

- 2. 知识产权试点示范城市四级指标框架及排名与分析
- 3. 知识产权试点示范园区四级指标框架及排名与分析
- 4. 知识产权试点单位四级指标框架及排名与分析
- 六、企业创造潜力三级指标框架及排名与分析
  - 1. 企业创造潜力三级指标框架及指数排名
  - 2. 企业科研基础四级指标框架及排名与分析
  - 3. 企业人才投入四级指标框架及排名与分析
  - 4. 企业资本投入四级指标框架及排名与分析
  - 5. 企业新产品开发四级指标框架及排名与分析
- 七、知识产权行政保护三级指标框架及排名与分析
  - 1. 知识产权行政保护三级指标框架及指数排名
  - 2. 专利行政执法四级指标框架及排名与分析
  - 3. 商标行政执法四级指标框架及排名与分析
  - 4. 海关行政执法四级指标框架及排名与分析
- 第七章 区域知识产权综合实力进步指标排名与分析
  - 一、知识产权综合实力进步指标框架
  - 二、知识产权综合实力进步指标排名与分析
  - 三、知识产权产出水平进步指标指数与排名
    - 1. 知识产权产出水平进步指标排名与分析
    - 2. 知识产权产出水平进步具体指标分析
  - 四、知识产权流动水平进步指标与排名
    - 1. 知识产权流动水平进步指标排名与分析
    - 2. 知识产权流动水平进步具体指标分析
  - 五、知识产权促进经济社会发展进步指标指数与排名
    - 1. 知识产权促进经济社会发展进步指标排名与分析
    - 2. 知识产权促进经济社会发展进步具体指标分析
  - 六、知识产权创造潜力进步指标指数与排名
    - 1. 知识产权创造潜力进步指标排名与分析
    - 2. 知识产权创造潜力进步具体指标分析
- 第八章 区域专利指标指数排名与分析
  - 一、专利指标框架
  - 二、专利指标指数及排名
  - 三、专利规模指标指数及排名
  - 四、专利效率指标指数及排名
  - 五、专利效益指标指数及排名
  - 六、专利发展速度指标指数及排名
  - 七、专利保护指标指数及排名
- 第九章 区域商标指标排名与分析
  - 一、商标指标框架
  - 二、商标指标指数及排名
  - 三、商标规模指标指数及排名
  - 四、商标活跃指标指数及排名
  - 五、商标效益指标指数及排名
  - 六、商标发展速度指标指数及排名
  - 七、商标保护指标指数及排名
- 专题研究一 完善我国的专利制度切实解决“专利泡沫”问题
  - 一、专利制度概述

## <<中国知识产权指数报告2011>>

- 二、我国“专利泡沫”情况的分析
- 三、我国“专利泡沫”产生的原因
- 四、解决“专利泡沫”的基本途径
- 专题研究二 我国专利资助政策的困境及出路
  - 一、专利资助政策的发展沿革及其基本内涵
  - 二、专利资助政策的公共政策分析
  - 三、专利资助政策的问题及原因
  - 四、解决专利资助政策弊端的对策
- 专题研究三 加强知识产权服务业建设——知识产权长足发展的助推器
  - 一、发展知识产权服务业的重要性
  - 二、我国知识产权服务业的发展现状
  - 三、知识产权服务业发展中存在的问题
  - 四、发展知识产权服务业的对策建议
- 专题研究四 国家在战略性新兴产业中的知识产权保护政策研究
  - 一、战略性新兴产业与知识产权保护概述
  - 二、战略性新兴产业发展中知识产权保护面临的挑战
  - 三、发展战略性新兴产业的知识产权制度创新与回应
- 专题研究五 国家在文化产业中的知识产权保护政策研究
  - 一、文化产业的基本界定
  - 二、文化产业中的知识产权保护现状——从几个典型案例开始说起
  - 三、文化产业中的知识产权保护存在的问题及其原因
  - 四、国家在文化产业中的知识产权保护政策初探
- 专题研究六 知识产权的“中国特色”研究
  - 一、知识产权制度建设
  - 二、知识产权保护
  - 三、知识产权运用
  - 四、知识产权文化
  - 五、科技创新、一体化下的中国知识产权制度发展
- 专题研究七 主要产业国集成电路布图设计的立法比较研究
  - 一、主要产业国对集成电路布图设计的立法保护
  - 二、集成电路布图设计各国（地区）立法保护的比较
- 附录一 各省（区、市）知识产权综合实力分项指标指数及排名
  - （附录）表1—1 北京知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—2 上海知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—3 广东知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—4 江苏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—5 浙江知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—6 山东知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—7 天津知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—8 福建知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—9 辽宁知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—10 湖南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—11 湖北知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—12 重庆知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—13 四川知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—14 河南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
  - （附录）表1—15 安徽知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表



<<中国知识产权指数报告2011>>

- (附录)表1—16 陕西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—17 河北知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—18 吉林知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—19 黑龙江知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—20 山西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—21 江西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—22 内蒙古知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—23 海南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—24 广西知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—25 云南知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—26 贵州知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—27 甘肃知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—28 宁夏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名
- (附录)表1—29 新疆知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—30 西藏知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表
- (附录)表1—31 青海知识产权综合实力分项指标指数及综合排名表

附录二 区域知识产权综合实力评价指标体系设计

附录三 数据处理

附录四 综合评价指数的计算

后记

章节摘录

版权页：插图：3.保护期限根据《半导体芯片法》规定，对掩膜作品的保护期限，从保护产生开始，到第10年的年终。

4.专有权《半导体芯片法》把掩膜作品所有人的权利规定为一种专有权。

受保护的掩膜作品所有人对实施或授权实施下列行为享有专有权：（1）利用光学、电子学或者其他任何方式复制掩膜作品；（2）进口或者分销含有该掩膜作品的半导体芯片产品；（3）促使或有意导致他人进行上述行为。

5.对专有权的限制《半导体芯片法》对专有权的限制有三个方面。

一是反向工程。

单纯为了教学、分析或鉴定结合在掩膜作品中的技术概念、或者掩膜作品中使用的电路、逻辑流程、元件组成的目的而复制掩膜作品的，不视为侵权。

把上述分析、鉴定的结果应用到一个新的具有独创性的掩膜作品中进行制造、分销，也不视为侵权。

二是首次出售。

对掩膜作品所有人制造或经其许可的人制造的某一特定的半导体芯片产品，该产品的所有人不经掩膜作品所有人授权而进口、分销或以其他方式处置或使用该特定产品，不视为侵权。

三是善意买主。

善意买主在知道该半导体芯片产品中所包含的掩膜作品享受保护之前进口或销售半导体芯片侵权产品的，不承担侵权责任。

在了解该半导体芯片产品中的掩膜作品受保护之后，对其进口或销售的半导体芯片侵权产品，只负就每件产品缴纳合理许可使用费的责任。

6.保护请求的登记美国版权法对掩膜作品的保护不是自动产生的。

只有在版权登记处进行登记的掩膜作品才能受到保护。

根据《半导体芯片法》规定，掩膜作品所有人可以向版权登记处申请登记。

在申请登记之前，给予2年的临时保护。

如果首次商业利用之日起2年内未申请登记，则此种保护将终止。

7.掩膜作品标记受保护的掩膜作品的所有人可以在其掩膜作品、掩膜和应用掩膜作品的半导体芯片产品上作出标记，以提醒他人对上述保护给予适当注意。

掩膜作品标记不构成掩膜作品受保护的条件，但可以构成知道保护存在的初步证据，以对抗自称为善意侵权的人。

8.专有权的行使及侵权诉讼掩膜作品所有人有权要求禁止侵权产品的进口，并可要求没收进口侵权产品并加以销毁，还可要求法院下达临时限制令、中间禁令或永久禁令，并责令侵权人赔偿被侵权人的实际损失。

任何人以商业行为或者影响商业的行为侵犯了掩膜作品所有人的专有权，均应承担侵权责任。

在登记证书颁发以后，受保护掩膜作品的所有人，或者独占许可的被许可人，均有权对于发生在保护产生以后的侵权行为提起民事诉讼。

在审理期间，法院有权扣押侵权半导体芯片产品。



## <<中国知识产权指数报告2011>>

### 编辑推荐

《中国知识产权指数报告2011》：全面分析知识产权各类指标、数据，揭示知识产权发展状况与经济增长模式，及竞争力水平的关系。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>